SPV 法を用いた GaAs 歪緩和層挿入 InGaAs/GaAsP 系量子井戸 太陽電池のキャリア輸送評価

武田 秀明^{a)}・中村 翼^{b)}・魯 家男^{a)}・K. Toprasertpong^{c)} 杉山正和^{d)}・碇 哲雄^{c)}・福山 敦彦^{f)}

Investigation of Carrier Transport in GaAs-interlayer-inserted Strain-Balanced InGaAs/GaAsP Quantum Well Solar Cells

Hideaki TAKEDA, Tsubasa NAKAMURA, Jianan LU, Kasidit TOPRASERTPONG, Masakazu SUGIYAMA,

Tetsuo IKARI, Atsuhiko FUKUYAMA

Abstract

We investigated carrier transport properties in three types of strain-balanced InGaAs/GaAsP quantum well solar cells by using the surface photovoltage (SPV) spectroscopy. First absorbing layer was multiple quantum well (MQW) and second was super-lattice (SL). Last one was GaAs-interlayer-inserted SL structure to relax the strain caused by the lattice mismatch. Distinct SPV signals were observed below the GaAs bandgap energy for all samples. In addition, the SPV signal intensities of SL and GaAs-interlayer samples were larger than that of MQW sample. From the computational calculation by using 3-D nano device simulator, the 1st quantum level of electron (e1) in SL sample and 2nd quantum level of electron (e2) and 1st quantum level of light hole (lh1) in GaAs-interlayer sample were found to form minibands because of the overlapping of wave functions. In these case, carriers can transport by tunneling through minibands without recombination. Since the SPV detects the surface potential change caused by carrier collection, large SPV signals obtained for SL and GaAs-interlayer samples represented that the carrier transport properties were improved by the formation of miniband. On the other hand, the SPV spectrum of SL sample showed two distinctive peaks corresponding to the mini-Brillouin zone center and edge of e2-miniband. The usefulness of SPV for investigating the carrier transport properties in quantum well solar cells was clearly demonstrated.

Keywords: Quantum-well solar cells, Superlattice, Miniband formation, carrier transport property

1. はじめに

近年、化石燃料の枯渇問題や地球温暖化などの環境問題 に加え、原子力発電の安全性が不安視されていることから、 安全かつ持続可能なエネルギー供給源の実用化が急務で ある。その再生可能且つクリーンなエネルギー源として太 陽光発電が注目されている。なかでも、太陽光スペクトル の光吸収波長領域が異なる半導体 *p-n* 接合を複数組み合わ せることで、変換効率の飛躍的向上を図る多接合型太陽電 池¹⁾が提案されている。実際に InGaP/InGaAs(GaAs)/Geの 三接合太陽電池において、約 364 倍の集光動作で変換効

- a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生
 b) 農学工学総合研究科 博士課程学生
 c) 東京大学工学研究科 博士課程学生
 d) 東京大学工学研究科 教授
 e) 電子物理工学科 特任教授
- f) 電子物理工学科 教授

率 41.6%を達成しており、更なる高効率化が期待されてい る²⁾。しかしながらこの三接合太陽電池においては、ミド ルセルの吸収波長領域が他のトップおよびボトムセルよ りも狭い²⁾ために出力電流が小さくなる。その結果、セル 全体の出力電流が、最も小さいミドルセルに律速されてし まう電流不整合損失が発生する。そこで、ミドルセルとし て通常の半導体 p-n 接合ではなく多重量子井戸(multiple quantum well: MQW)を挿入した MQW 太陽電池が提案さ れている³⁾。異なる禁制帯幅を持つ材料を数 nm 程度の厚 さで交互に積層させて井戸型ポテンシャルを実現してい る。この井戸幅や障壁高さを変化させることで離散化準位 を制御することが可能であり、光吸収波長を長波長化させ て出力電流を増加させる。例えば、英国 Imperial College の研究グループが、従来型の InGaP/GaAs 二接合タンデム セルの GaAs サブセル中に InGaAs/GaAsP 系の歪補償多重 量子井戸構造を導入することで、変換効率 30.7% (AM 1.5、 54 倍集光)4を達成したことを報告している。



図 1. MQW(実線)および SL(破線)の状態密度 とエネルギーの関係

量子井戸内に形成された光励起キャリアは、熱励起によ って井戸外へ脱出し両電極へ到達する。しかしながら、同 時に量子井戸の閉じ込め効果により井戸構造内で再結合 して消失するために、キャリア収集効率が低下することが 課題である。その結果、従来型セルと比較して十分な特性 向上が得られない場合が多く、量子井戸挿入の優位性を示 すには至っていない。その解決策として超格子 (superlattice: SL)太陽電池が考案されている。SLとは MQW の障壁層幅を数ナノメートル程度に薄くした構造である。 この結果、隣り合う量子井戸の波動関数が重なり合うこと でバンドを形成(ミニバンド化)する。この結果、電子の存 在を表す状態密度関数が、MQW 特有のステップ関数から 二つの特異点(Γとπ点)をもつシグモイド関数に類似した 形状へ変化する(図1)。特にSL太陽電池では、光励起キ ャリアが、形成されたミニバンド内を再結合することなく トンネリングすることでキャリア輸送されるため、太陽電 池のキャリア収集効率が飛躍的に上昇することが期待さ れる 5)。

しかしながら、数ナノメートル程度の非常に薄い膜を積 み重ねることから、ヘテロ接合界面の蓄積歪による欠陥の 発生を避けられない。MQW あるいは SL 領域の総合膜厚 が非常に薄いため、十分な太陽光吸収を起こすためには、 数十程度の積層数が必要となり、良質な MQW や SL 構造 の成膜が困難である。この課題を解決する方法に井戸層と 障壁層の間に歪緩和層を挿入する手法がある。歪緩和層の 挿入により、蓄積歪を緩和できるため MQW および SL 層 の結晶品質が向上する。実際に、疑似太陽光照射下での電 流一電圧特性およびキャリア収集効率測定から、キャリア 収集効率が改善したとの報告があるのが、太陽電池構造を 作成した最終段階での評価のみであり、内部電界等を考慮 した詳細なバンド構造計算や形成される量子準位の光学 的特性評価についての報告はない。本研究では、量子構造 及び内部電界を考慮できる有限差分法によるシミュレー ションソフトウェア nextnano を用いて、MQW と SL、お よび歪緩和層を挿入した量子井戸太陽電池のバンド構造 を計算した。そして、表面光起電力(Surface photovoltage: SPV)測定の結果と比較し、歪緩和層を挿入した際のキャ リア輸送について議論した。

2. 実験

本研究では、n-GaAs基板上に量子井戸構造を光吸収層 とするp-i-n GaAs太陽電池試料を準備した。図2に示すよう に、量子井戸構造成膜時にInGaAs井戸層幅を5.1 nmに固定 し、GaAsP障壁層幅を7.8と2.0 nmとした試料を準備した。 以後、それぞれMQWとSL試料とする。また、3.1 nmの InGaAs井戸層と2.1 nmのGaAsP障壁層の間にGaAs歪緩和



図 2. p-i-n 構造に量子井戸を挿入した試料詳細

層を2.1 nm挿入した試料をinterlayer試料とする。これら量 子井戸構造は、3 つの試料全てにおいて20周期積層させた。 全ての層は有機金属気相成長法⁷⁾で成長させた。SPV測定 は、励起光としてハロゲン光源を分光した断続単色光を *p*-GaAs膜側から照射し、試料表面と裏面に蓄積したキャ リアによる表面電位変化をITOで検出した。全ての測定は 室温で実施した。

3. 実験結果および考察

図3に室温で得られた各試料のSPV スペクトルを示す。 全ての試料で観測された1.43 eV 以上の信号は、室温にお けるGaAsのバンドギャップ(1.42 eV)と一致したことから、 試料表面側に存在するp-GaAs層内でのバンド間遷移に起 因する信号であると同定した。より低エネルギー側で観測 された1.30と1.38 eV 付近の信号は光吸収 i層に挿入され た量子構造の量子準位間遷移に起因すると判断した。そこ で、nextnanoを用いて有限差分法によるバンド構造計算を 行った。用意した試料構造から、全ての試料の光吸収 i層 の内部電界強度 F は1.2 mV/nm であった。それを基に、 各試料の20周期の量子井戸計算モデルを構築した。構築



図3. 各試料のSPV スペクトル

したモデルに対して有効質量近似を適用し、電子の存在確 率をシミュレーションした。計算された MQW と SL、 interlayer 試料のバンド構造と各量子準位における電子の 存在確率をそれぞれ図 4、5、6 に示す。MQW 及び SL 試 料では一般的な量子井戸である井戸型ポテンシャルにな っているのに対して、interlayer 試料では障壁層と井戸層の 間に GaAs 緩和層を挿入したことにより階段状のポテンシ ャルになっていることが分かった。電子の存在確率のシミ ュレーション結果より、図4に示す MQW 試料では伝導帯 中電子の第1量子準位(el)の存在確率が各井戸内に孤立し ている一方、図5に示すSL 試料ではその存在確率が隣接 井戸に染み出していた。つまり、SL 試料の el はミニバン ド化していることが分かった。他方、interlayer 試料では el の存在確率は井戸内に孤立していたが、伝導帯中電子 の第2量子準位(e2)と価電子帯中軽い正孔の第1量子準位 (lh1)の存在確率が隣接する井戸へ染み出しており、これら の準位もミニバンド化していることが分かった。

次に、シミュレーションによって算出された量子準位からそれらの遷移エネルギーを算出し(計算値)、SPV スペクトルに観測されたピーク位置(実験値)を比較してそれらピークの起因を同定した。MQW と interlayer 試料に観測された 1.30 eV 付近の SPV ピークにガウス関数をフィッティングした結果、それぞれ 1.308 と 1.314 eV のピークエネルギーが算出された。これらは e1 と価電子帯中重い正孔の第1量子準位(hh1)間の遷移エネルギー(e1-hh1)の計算値(MQW 試料: 1.297, interlayer 試料: 1.294 eV)に近い値を示したことから、e1-hh1 遷移によって形成されたキャリアが輸送され試料表面あるいは裏面へ蓄積されて生じたSPV 信号であると同定した。

一方、SL 試料の SPV スペクトルは、他の2 試料の場合 とは異なり、1.3 eV 近辺に一つの鋭いピークは観測されず、 1.297 と 1.332 eV の2 つのピークに分離したスペクトル形 状となった。これらのエネルギーは el がミニバンド化し





た際のミニブリリュアン領域中心 $[e1(\Gamma)]$ 及び端 $[e1(\pi)]$ と hh1 間の遷移エネルギー $[e1(\Gamma)-hh1 \ge e1(\pi)-hh1]$ の計 算値(1.285 ≥ 1.336 eV)に近い値を示した。従って、量子準 位 e1 がミニバンド化したことに起因した SPV 信号である と同定した。SL 試料の e1(Γ)-hh1 遷移が MQW や interlayer 試料の e1-hh1 遷移よりも低エネルギー側に観測されたの は、e1 のミニバンド化によって実効的なバンドギャップ が減少したためである。

interlayer 試料にのみ観測された 1.38 eV 付近の信号は 2 つのピーク(1.370 と 1.386 eV) に分離することができた。 これらは el と、lh1 がミニバンド化した際のミニブリリュ アン領域中心及び端間の遷移エネルギー [el-lh1(Γ)と el-lh1(π)]の計算値(1.372 と 1.386 eV)と非常に良い一致を 示した。つまり、SPV 測定によって lh1 のミニバンドに起 因した信号が明確に取得されたことが分かった。なお、SL と MQW 試料の el-lh1 の遷移エネルギーは、それぞれ 1.429 と 1.419 eV であり、試料表面側にある *p*-GaAs 層のバンド ギャップ遷移に隠れてしまい、明確に検出出来なった。

試料ごとのキャリア輸送について議論するため、SPV 信号強度に注目した。SPV 測定では、試料表面及び裏面に 蓄積した光励起キャリアによる電位変化を測定するため、 その信号強度の比較からミニバンド形成や歪緩和層挿入 がキャリア輸送に与える影響を評価することができる。 1.30 eV 付近の信号に注目すると、SL 試料では MQW 試料 に比べて信号強度が増加した。これは el がミニバンド化 したことで、形成されたキャリアがトンネル効果により輸 送され、結果として光吸収 i 層内でのキャリア再結合損失 が減少したためだと考えられる。一方、interlayer 試料でも el がミニバンド化していないにも関わらず、SL 試料より も大きい SPV 信号強度となった。この実験結果は以下の ように理解することができる。まず、MQW および interlayer 試料において el-hh1 遷移で形成されるキャリア の数は同じであると考えられる。MQW 試料の場合、el に光励起された電子は熱エネルギーを得て障壁層上端ま で励起され、隣接井戸に移動する。これを繰り返すことで キャリアが輸送され、最終的に SPV 信号となる。当然な がらその途中の量子準位において再結合し消失する可能 性が高い。一方、interlayer 試料では、el に光励起された 電子は障壁層上端よりエネルギーの低い e2 ミニバンドへ 熱励起され、トンネリング効果によって量子井戸構造から 容易に脱出することができる。結果として SPV 信号強度 が大きくなったと解釈することが可能である。SL 試料に おいて el もミニバンド化しているが、図 5 から明らかな ように i-GaAs 層の伝導帯下端よりもミニバンドが低エネ ルギー側に存在しているため、SL 構造右端ヘトンネリン グしてきた電子が i-GaAs 層へ移動する際に最後の障壁層 を熱的に乗り越える必要がある。結果として、表面へ蓄積 されるキャリア量が減少し、interlayer 試料よりも SPV 信 号強度が減少したと考えられる。以上の結果から、量子準 位のミニバンド化はキャリア輸送の効率化に非常に有効 であるが、ミニバンドが形成されるエネルギー位置と *i*-GaAs の伝導帯下端との関係も極めて重要であることが 明らかとなった。1.43 eV 付近の信号強度についても、同 様の理由により interlayer 試料で信号強度が最も大きくな ったと考えられる。

4. 結論

本研究では、*p-i-n* GaAs 太陽電池の光吸収 *i* 層の量子井 戸構造が異なる MQW、SL、interlayer の 3 つの試料に対し て SPV 測定を行い、キャリア輸送について議論した。 遷移エネルギーの計算値と SPV ピーク位置を比較した ところ、SL と interlayer 試料ではそれぞれ e1 と lh1 が ミニバンド化し、状態密度関数を反映するスペクトル 形状に変化し、且つ SPV 信号が増加した。

1.30 eV 付近の SPV 信号強度に注目したところ、SL と interlayer 試料では MQW 試料に比べ信号強度が増加 した。SL では el のミニバンド化によりキャリア輸送 が促進されたと考えられ、一方 interlayer 試料では el に光励起された電子が e2 ミニバンドへ熱励起し、量子 井戸構造からのキャリア脱出が容易になったことで SPV 信号強度が増加することが分かった。更に、e2 ミ ニバンドは *i*-GaAs 層の伝導帯下端よりも高エネルギー 側に存在しているため、量子井戸構造層から *i*-GaAs 層 へ移動する際のエネルギー損失が少ない。本研究成果 から、キャリア輸送において量子準位のミニバンド化 が有効であるが、形成されるミニバンドの量子準位の 位置がキャリア輸送効率の低下を及ぼすことが示され た。

謝辞

良質な試料を提供して頂きました東京大学の杉山正和 准教授に感謝致します。また本研究の一部は、NEDO超高 効率・低コスト太陽電池研究開発による委託及び文科省科 研費(基盤BおよびC)の支援を受けて実施されました。

参考文献

- M. Yamaguchi, Aurangzeb Khan, Nethaji Dharmarasu: "Analysis for superior radiation resistance of InP-based solar cells", Solar Energy Materials & Solar Cells", Vol. 75, pp.261-269, 2003.
- 2) R. R. King, A. Boca, W. Hong, X.-Q. Liu, D. Bhusari, D. Larrabee, K. M. Edmondson, D. C. Law, C. M. Fetzer, S. Mesropian, and N. H. Karam: "Band-Gap-Engineered Architectures for High-Efficiency Multijunction Concentrator Solar Cells", Proc. 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.55-61,2009.

- K. W. J. Barnham, G. Duggan: "A new approach to high-efficiency multi-band-gap solar cell", J. Appl. Phys., Vol. 67, pp.3490-3493, 1990.
- 4) A. Ioannides, T.N.D. Tibbits, J. P. Connolly, D. B. Bushnell, K. W. J. Barham, C. Calder, G. Hill, J. S Roberts, G. Smekens, J. Van Begin: "Advance in strain Balanced Quantum Well Tandem Solar Cell", Proc. 22nd European photovoltaic Solar Energy Conference, pp.221-224, 2007.
- 5) T. Aihara, A. Fukuyama, Y. Yokoyama, M. Kojima, H. Suzuki, M. Sugiyama, Y. Nakano, T. Ikari: "Detection of miniband formation in strain-balanced InGaAs/GaAsP quantum well solar cells by using a piezoelectric photothermal spectroscopy", J. Appl. Phys., Vol. 116, p.44509, 2014.

6) K. Toprasertpong, N. Kasamatsu, H. Fujii, T. Kada, S. Asahi, Y. Wang, K. Watanabe, M. Sugiyama, T. Kita and Y. Nakano, "Carrier Time-of-Flight Measurement Using a Probe Structure for Direct Evaluation of Carrier Transport in Multiple Quantum Well Solar Cells", IEEE Journal of Photovoltaics, Vol. 4, pp.1518-1525, 2014.

7) Y. Wang, S. Ma, K. Watanabe, M. Sugiyama, Y. Nakano: "Management of highly-strained heterointerface in InGaAs/GaAsP strain-balanced superlattice for photovoltaic application", Journal of Crystal Growth, Vol. 352, p.194, 2012.